PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-296611

(43)Date of publication of application: 24,10,2000

(51)Int.CI.

B41J 2/045

B41J 2/055 B41J 2/16

(21)Application number: 11-107237

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

14.04.1999

(72)Inventor: OKA HIROSHI

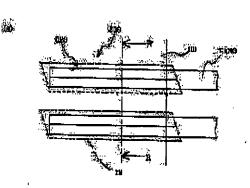
SHIMADA KATSUTO

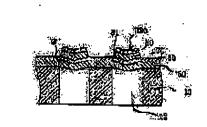
(54) INK JET RECORDING HEAD AND PRODUCTION THEREOF AND INK JET RECORDING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet recording head capable of enhancing piezoelectric characteristics without increasing the width of a piezoelectric element, a method for producing the same and an ink jet recording apparatus.

SOLUTION: In an ink jet recording head equipped with a piezoelectric element 30 consisting of the lower electrode 60 provided on a vibration plate constituting a part of a pressure generating chamber 12 communicating with a nozzle orifice, the piezoelectric layer 70 provided on the lower electrode 60 and the upper electrode 80 provided on the surface of the piezoelectric layer 70, the region opposed to the pressure generating chamber 12 of the vibration plate is provided as the projected part 51 provided so as to be inclined to one side of the thickness direction of the vibration plate from both ends in the lateral direction of the pressure generating chamber to the central part thereof and at least the part on the side of the vibration plate of the piezoelectric layer is provided





along the shape of the projected part 51 to increase the vol. of the piezoelectric layer 7 without increasing the width of the piezoelectric element 300.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号 特開2000-296611 (P2000-296611A)

(43)公開日 平成12年10月24日(2000.10.24)

(51) Int.Cl.'		識別記号	ΡI		テーヤスード(参考)
B41J	2/045		B41J	3/04	103A 2C057
	2/055				103H
	2/16				

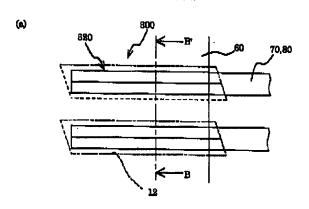
		警查請求	未請求 請求項の数11 OL (全 10 頁)		
(21) 出願番号	特膜平 11-107237	(71)出頭人	000002369		
(22)出顯日	平成11年4月14日(1999.4.14)	(72)発明者	セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 5 邱 宏		
			兵野県諏訪市大和8丁目8番5号 セイコ ーエプソン株式会社内		
		(72)発明者	長野県献助市大和8丁目3番5号 セイコ		
		(74)代理人	ーエプソン株式会社内 100101236		
			中国士 栗原 治之		
			最終頁に続く		

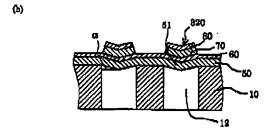
(54) 【発明の名称】 インクジェット式記録ヘッド及びその製造方法並びにインクジェット式記録装置

(57)【要約】

【課題】 圧電素子の幅を広げることなく圧電特性を向 上することのできるインクジェット式記録ヘッド及びそ の製造方法並びにインクジェット式記録装置を提供す ቆ.

【解決手段】 ノズル開口に連通する圧力発生室 7 2 の 一部を構成する振動板上に設けられた下電極6Q、該下 電極60上に設けられた圧電体層70及び該圧電体層7 ○の表面に設けられた上電極80からなる圧電素子30 Oを備えるインクジェット式記録ヘッドにおいて、前記 振動板の前配圧力発生窒12に対向する領域が当該圧力 発生室12の幅方向両端部から中央部に向かって前記振 動板の厚さ方向一方側に傾斜して設けられた突出部51 となっており、前記圧電体層の少なくとも前記振動板側 が前記突出部51の形状に沿って設けられていることに より、圧電素子300の幅を広げることなく圧電体層で 0の体積が増加する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノズル開口に遠通する圧力発生室の一部を構成する振動板上に設けられた下電極、該下電極上に設けられた圧電体層及び該圧電体層の表面に設けられた上電極からなる圧電素子を備えるインクジェット式記録へッドにおいて、

前記扱動板の前配圧力発生室に対向する領域が当該圧力 発生室の幅方向両端部から中央部に向かって前記振動板 の厚さ方向一方側に傾斜して設けられた突出部となって おり、前配圧電体層の少なくとも前配振動板側は前能突 出部の形状に沿って設けられていることを特徴とするイ ンクジェット式記録ヘッド。

【請求項2】 請求項1において、前記突出部は、前記 圧力発生室が形成された際の応力を除去した状態で前記 圧力発生室側に突出していることを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項3】 請求項1又は2において、前配突出部の 横断面形状が略山形を有することを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項4】 請求項3において、前配突出部の先端部がR形状となっていることを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項6】 請求項1~5の何れかにおいて、前配注 電体層の前配上電極側の表面が、前配突出部以外の領域 の前配振動板と略平行な平行面となっていることを特徴 とするインクジェット式配録ヘッド。

【請求項7】 請求項1~6の何れかにおいて、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項8】 請求項1~7の何れかのインクジェット 式記録ヘッドを具備することを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項9】 圧力発生室を形成する基板の一方面に設けられた弾性膜上に下電極層、圧電体層及び上電極層を順次積層して各層をパターニングすることにより前配圧力発生室に対応する領域に前配圧電体層及び前配上電極からなる圧電素子を形成するインクジェット式配録ヘッドの製造方法において、

前記基板の一方面側をパターニングすると共に前記弾性 膜を形成して、前記基板の前配圧力発生室となる領域の 前記弾性膜を前配圧力発生室の幅方向両端部から中央部 に向かって前記弾性膜の厚さ方向一方側に傾斜して設け られる突出部を形成する第1の工程と、前記弾性膜上に 前記下電極層、圧電体層及び前記上電極を成膜及びパタ ーニングして前配圧電素子を形成する第2の工程と、前 記基板を他方面側から前記弾性膜に達するまでエッチン グして前配圧力発生室を形成する第3の工程とを有する ことを特徴とするインクジェット式記録ヘッドの製造方 法。

【請求項10】 請求項9において、前配第1の工程は、前配基板の圧力発生室に対向する領域をパターニングして凹部を形成する工程と、前配基板上に前配凹部の形状に沿って前配弾性膜を形成する工程とを有することを特徴とするインクジェット式配録へッドの製造方法。

【簡求項11】 請求項9において、前配第1の工程は、前記基板をパターニングして、前配圧力発生室に対向する領域に前配圧力発生室とは反対側に突出する凸部を形成する工程と、前記基板上に前配凸部の形状に沿って前記弾性膜を形成する工程とを有することを特徴とするインクジェット式記録ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インク滴を吐出するノズル開口と遠通する圧力発生室の一部に振動板を介して圧電素子を形成して、圧電素子の変位によりインク滴を吐出させるインクジェット式記録を宣に関する。

[0002]

【従来の技術】インク滴を吐出するノズル閉口と速通する圧力発生室の一部を援動板で構成し、この援動板を圧電素子により変形させて圧力発生室のインクを加圧してノズル閉口からインク滴を吐出させるインクジェット式配録ヘッドには、圧電素子が軸方向に伸長、収縮する機振動モードの圧電アクテュエータを使用したものの2種類が実用化されている。

【0003】前者は圧電素子の端面を振動板に当接させることにより圧力発生室の容積を変化させることができて、高密度印刷に適したヘッドの製作が可能である反面、圧電素子をノズル開口の配列ピッチに一致させて櫛歯状に切り分けるという困難な工程や、切り分けられた圧電素子を圧力発生室に位置決めして固定する作業が必要となり、製造工程が複雑であるという問題がある。

【0004】これに対して後者は、圧電材料のグリーンシートを圧力発生室の形状に合わせて貼付し、これを焼成するという比較的簡単な工程で振動板に圧電索子を作り付けることができるものの、たわみ振動を利用する関係上、ある程度の面積が必要となり、高密度配列が困難であるという問題がある。

【0006】一方、後者の記録ヘッドの不都合を解消すべく、特開平5-286131号公報に見られるように、扱動板の表面全体に亙って成膜技術により均一な圧電材料層を形成し、この圧電材料層をリングラフィ法により圧力発生室に対応する形状に切り分けて各圧力発生

童毎に独立するように圧電素子を形成したものが提案されている。

【0006】これによれば圧電素子を振動板に貼付ける 作業が不要となって、リソグラフィ法という精密で、か つ簡便な手法で圧電素子を作り付けることができるばか りでなく、圧電素子の厚みを薄くできて高速駆動が可能 になるという利点がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述のような構成のインクジェット式記録ヘッドにおいて、さらに駆動速度を向上しようとすると、圧電素子の圧電材料層の体積を増加させる必要があり、圧電素子の幅又は厚さを増加して体積を増加させると圧電特性は向上するものの、圧力発生室の幅が同一の場合には、これに伴って振動板の剛性が高まる等の理由により振動板の十分な変位量が得られないという問題がある。

【0008】本発明は、このような事情に鑑み、圧電素子の幅を広げることなく圧電特性を向上することのできるインクジェット式配録へッド及びその製造方法並びにインクジェット式配録装置を提供することを課題とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様は、ノズル開口に連通する圧力発生室の一部を構成する振動板上に設けられた下電極、該下電極上に設けられた圧電体層及び該圧電体層の表面に設けられた上電極からなた、前記振動板の前配圧力発生室に対向する領域が当該圧力発生室の幅方向両端部から中央部に向かっており、前配圧電体層の少なくとも前配振動板側は前配突出部の形状に沿って設けられていることを特徴とするインクジェット式記録へッドにある。

【0010】かかる第1の態様では、圧電体層の幅を変えることなく体積を増加することができるため、圧力発生室の幅を変えることなく圧電素子の駆動力を増加させることができる。

【0011】本発明の第2の態様は、第1の態様において、前記突出部は、前記圧力発生室が形成された際の応力を除去した状態で前記圧力発生室側に突出していることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0012】かかる第2の態様では、圧力発生室の容積が小さくなるため、単位容積あたりの圧電素子の駆動力がさらに増加する。

【0013】本発明の第3の態様は、第1又は2の態様において、前記突出部の横断面形状が略山形を有することを特徴とするインクジェット式記録へッドにある。

【0014】かかる第3の態様では、突出部を比較的容易に形成できる。

【0015】本発明の第4の態様は、第3の態様におい

て、前配突出部の先端部がR形状となっていることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0016】かかる第4の態様では、突出部の先端部への電場集中が抑えられ、圧電体層の破壊が防止される。

【0017】本発明の第5の態様は、第1~4の何れかの態様において、前記突出部以外の領域の前記摄動板に沿った面に対する前記突出部の傾斜角度が30°以下であることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0018】がかる第5の態様では、効果的に、圧電素 子の駆動力を増加させることができる。

【0019】本発明の第6の態様は、第1~5の何れかの態様において、前記圧電体層の前記上電極側の表面が、前記突出部以外の領域の前記振動板と略平行な平行団となっていることを特徴とするインクジェット式記録へッドにある。

【0020】かかる第8の態様では、圧電素子の駆動力が増加され、且つ圧電体層を比較的容易に形成することができる。

【0021】本発明の第7の態様は、第1~6の何れかの態様において、前配圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前配圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0022】かかる第7の態様では、高密度のノズル開口を有するインクジェット式記録ヘッドを大量に且つ比較的容易に製造することができる。

【〇〇23】本発明の第8の態様は、第1~7の何れかの態様のインクジェット式記録ヘッドを具備することを 特徴とするインクジェット式記録装置にある。

【0024】かかる第8の態様では、ヘッドのインク吐出特性を向上したインクジェット式記録装置を実現することができる。

【0025】本発明の第9の態様は、圧力発生室を形成 する基板の一方面に設けられた弾性膜上に下電極層、圧 電体層及び上電極層を順次積層して各層をパターニング することにより前記圧力発生室に対応する領域に前記圧 電体層及び前配上電極からなる圧電素子を形成するイン クジェット式記録ヘッドの製造方法において、前記基板 の一方面側をパターニングすると共に前記弾性膜を形成 して、前記基板の前配圧力発生室となる領域の前記弾性 膜を前配圧力発生室の幅方向両端部から中央部に向かっ. て前記弾性膜の厚さ方向一方側に傾斜して設けられる第 1の工程と、前記弾性膜上に前記下電極層、圧電体層及 び前記上電極を成膜及びパターニングして前記圧電素子 を形成する第2の工程と、前配基板を他方面側から前配 弾性膜に遊するまでエッチングして前記圧力発生室を形 成する第3の工程とを有することを特徴とするインクジ ェット式記録ヘッドの製造方法にある。

【0026】かかる第9の態様では、基板をパターニン グすることにより、弾性膜の突出部を比較的容易に形成 することができる。

【〇〇27】本発明の第10の態様は、第9の態様にお いて、前記第1の工程は、前記基板の圧力発生室に対向 する領域をパターニングして凹部を形成する工程と、前 記基板上に前記凹部の形状に沿って前記弾性膜を形成す る工程とを有することを特徴とするインクジェット式記 録ヘッドの製造方法にある。

【〇〇28】かかる第10の態様では、基板の形状に沿 って弾性膜を形成することにより、圧力発生室側に突出 する突出部を容易に形成することができる。

【0029】本発明の第11の麒様は、第9の態様にお いて、前記第1の工程は、前記基板をパターニングし て、前記圧力発生室に対向する領域に前記圧力発生室と は反対側に突出する凸部を形成する工程と、前記基板上 に前記凸部の形状に沿って前記弾性膜を形成する工程と を有することを特徴とするインクジェット式配録ヘッド の製造方法にある。

【〇〇3〇】かかる第11の態様では、基板の形状に沿 って弾性膜を形成することにより、圧力発生室とは反対 側に突出する突出部を容易に形成することができる。

[0031]

【発明の実施の形態】以下に本発明を実施形態に基づい て詳細に説明する。

【〇〇32】(実施形態1)図1は、本発明の実施形態 1に係るインクジェット式記録ヘッドを示す分解糾視図 であり、図2は、平面図及びその1つの圧力発生室の長 手方向における断面構造を示す図である。

【0033】図示するように、流路形成基板10は、本 実施形態では面方位(110)のシリコン単結晶基板か らなる。流路形成基板10としては、通常、150~3 00μm程度の厚さのものが用いられ、望ましくは18 0~280 µ m程度、より望ましくは220 µ m程度の 厚さのものが好適である。これは、隣接する圧力発生室 間の隔壁の剛性を保ちつつ、配列密度を高くできるから である。

【0034】流路形成基板10の一方の面は開口面とな り、他方の面には予め熱酸化により形成した二酸化シリ コンからなる、厚さ O。1~2μmの弾性膜 5 O が形成! されている。

【0035】一方、流路形成基板10の開口面には、シ リコン単結晶基板を異方性エッチングすることにより、 ノズル開口11、圧力発生産12が形成されている。

【0036】ここで、異方性エッチングは、シリコン単 結晶基板をKOH等のアルカリ溶液に浸渡すると、徐々 に侵食されて(110)面に垂直な第1の(111)面 と、この第1の(111)面と約70度の角度をなし且 つ上記(110)面と約35度の角度をなす第2の(1 11)面とが出現し、(110)面のエッチングレート

と比较して(111)面のエッチングレートが約1/1 80であるという性質を利用して行われるものである。 かかる異方性エッチングにより、二つの第1の(11 1) 面と斜めの二つの第2の(111)面とで形成され る平行四辺形状の深さ加工を基本として精密加工を行う ことができ、圧力発生室12を高密度に配列することが できる。

【0037】本実施形態では、各圧力発生室12の長辺 を第1の(111)面で、短辺を第2の(111)面で 形成している。この圧力発生室12は、流路形成基板1 0をほぼ貫通して弾性膜50に遊するまでエッチングす ることにより形成されている。なお、弾性膜50は、シ リコン単結晶基板をエッチングするアルカリ溶液に侵さ れる量がきわめて小さい。

【0038】一方、各圧力発生室12の一端に連通する 各ノズル開口11は、圧力発生産12より幅狭で且つ淺 く形成されている。すなわち、ノズル閉口11は、シリ コン単結晶基板を厚さ方向に途中までエッチング(ハー フエッチング)することにより形成されている。なお、 ハーフエッチングは、エッチング時間の調整により行わ れる。

【〇〇39】ここで、インク演吐出圧力をインクに与え る圧力発生室12の大きさと、インク滴を吐出するノズ ル開口11の大きさとは、吐出するインク滴の量、吐出 スピード、吐出周波数に応じて最適化される。例えば、 1インテ当たり360個のインク滴を記録する場合、ノ ズル開口 1 1 は数十μmの漢幅で精度よく形成する必要 がある。

【0040】また、各圧力発生産12と後述する共流イ ンク室31とは、後述する封止板20の各圧力発生室1 2の一端部に対応する位置にそれぞれ形成されたインク 供給連通口21を介して違通されており、インクはこの インク供給連通口21を介して共通インク室31から供 給され、各圧力発生室12に分配される。

【0041】封止板20は、前述の各圧力発生室12に 対応したインク供給連通口21が穿設された、厚さが例 えば、0.1~1mmで、線膨張係数が300℃以下 で、例えば2.5~4.5[×10^{~6}/℃]であるガラ スセラミックスからなる。なお、インク供給連通口21 は、図3 (a), (b)に示すように、各圧力発生<u>室</u>1 2のインク供給側端部の近傍を横断する一つのスリット 孔21Aでも、あるいは複数のスリット孔21日であっ てもよい。封止板20は、一方の面で流路形成基板10 の一面を全面的に覆い、シリコン単結晶基板を衝撃や外 力から保護する補強板の役目も果たす。また、封止板2 Oは、他面で共通インク室31の一壁面を構成する。

【〇〇42】共通インク室形成基板30は、共通インク **室31の周壁を形成するものであり、ノズル開口数、イ** ンク滴吐出周波数に応じた適正な厚みのステンレス板を 打ち抜いて作製されたものである。本実施形態では、共 通インク室形成基板30の厚さは、O.2mmとしている。

【0043】インク室側板40は、ステンレス基板から なり、一方の面で共通インク室31の一壁面を構成する。 ものである。また、インク室側板40には、他方の面の 一部にハーフエッチングにより凹部40aを形成するこ とにより薄肉壁41が形成され、さらに、外部からのイ ンク供給を受けるインク導入口42が打抜き形成されて いる。なお、薄肉壁41は、インク滴吐出の際に発生す るノズル関ロ11と反対側へ向かう圧力を吸収するため のもので、他の圧力発生窒12に、共通インク窒31を 経由して不要な正又は負の圧力が加わるのを防止する。 本実施形態では、インク導入口42と外部のインク供給 手段との接続時等に必要な剛性を考慮して、インク室側 板40を0.2mmとし、その一部を厚さ0.02mm の薄肉壁41としているが、ハーフェッチングによる薄 肉壁41の形成を省略するために、インク室側板40の 厚さを初めから0.02mmとしてもよい。

【0044】一方、流路形成基板10の開口面とは反対 側の弾性膜50上には、厚さが例えば、約0.5μmの 下電極膜60と、厚さが例えば、約1μmの圧電体膜7 Oと、厚さが例えば、約0.1μmの上電程膜80と が、後述するプロセスで積層形成されて、圧電素子30 〇を構成している。ここで、圧電素子3〇〇は、下電極 膜6.0、圧電体膜70、及び上電極膜80を含む部分を いう。一般的には、圧電素子300の何れか一方の電極 を共通電極とし、他方の電極及び圧電体膜70を各圧力 発生室12毎にパターニングして構成する。そして、こ こではパターニングされた何れか一方の電極及び圧電体 膜70から構成され、両電極への電圧の印加により圧電 歪みが生じる部分を圧電体能動部320という。本実施 形態では、下電極膜60は圧電素子300の共通電極と し、上電極膜80を圧電素子300の個別電極としてい るが、駆動回路や配線の都合でこれを逆にしても支障は ない。何れの場合においても、各圧力発生室毎に圧電体 能動部が形成されていることになる。また、ここでは、 圧電素子300と当該圧電素子300の駆動により変位 が生じる弾性膜とを合わせて圧電アクチュエータと称す る。なお、上述した例では、弾性膜50及び下電極膜6 口が振動板として作用するが、下電極膜が弾性膜を兼ね るようにしてもよい。

【0045】ここで、シリコン単結晶基板からなる流路 形成基板10上に、圧電体膜70等を形成するプロセス を図4及び図5を参照しながら説明する。なお、図4、 図5は、共に圧力発生室12の幅方向の断面図である。 【0046】図4(a)に示すように、流路形成基板1 0の圧力発生室12となる領域を、例えば、イオンミリング等によって除去して、圧力発生室12の幅方向両端 部から中央部に向かって傾斜する面で形成される凹部1 0aを形成する。次いで、この流路形成基板10となる シリコン単結晶基板のウェハを約1100℃の拡散炉で 熱酸化して、流路形成基板10の凹部108側に二酸化 シリコンからなる弾性膜60を形成する。

【0047】次に、図4(b)に示すように、スパッタリングで下電極膜60を形成する。この下電極膜60の材料としては、白金等が好適である。これは、スパッのリング法やソルーゲル法で成膜する後述の圧電体膜70は、成膜後に大気雰囲気下又は酸繁雰囲気下で600~100℃程度の温度で焼成して結晶化させる必要があるからである。すなわち、下電極膜60の材料は、これのようず、殊に、圧電体膜70としてテタン酸ジルコン酸のようず、殊に、圧電体膜70としてテタン酸ジルコン酸のようず、殊に、圧電体膜70としてテタン酸ジルコン酸(PZT)を用いた場合には、酸化鉛の拡散による導電性の変化が少ないことが望ましく、これらの理由から白金が好適である。

【0048】次に、図4(c)に示すように、スパッタリングによって圧電体膜70を下電極膜60の形状に沿って成膜する。この圧電体膜70の材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛(P2T)系の材料がインクジェット式配録へッドに使用する場合には好適である。なお、本実施形態では、圧電体膜70をスパッタリング法を用いているが、例えば、金属有機物を触媒に溶解・分散したいわゆるゾルを整布乾燥してゲル化し、さらに高温で焼成することで金属酸化物からなる圧電体膜70を得る、いわゆるゾルーゲル法を用いることもできる。

【0049】さらに、ソルーゲル法又はスパッタリング 法等によりP2Tの前躯体膜を形成後、アルカリ水溶液 中での高圧処理法にて低温で結晶成長させる方法を用い てもよい。

【0050】次に、図4(d)に示すように、上電極膜80を成態する。上電極膜80は、導電性の高い材料であればよく、アルミニウム、金、ニッケル、白金等の多くの金属や、導電性酸化物等を使用できる。本実施形態では、白金をスパッタリングにより成膜している。

【0051】その後、図5(a)に示すように、圧電体膜70及び上電極膜80のみをエッチングして圧電体能動部320のパターニングを行う。以上が膜形成プロセスである。また、このようにして膜形成を行った後、図5(b)に示すように、前述したアルカリ溶液によるシリコン単結晶基板の異方性エッチングを行い、圧力発生室12等を形成する。

【0062】以上説明した一連の膜形成及び與方性エッチングによって、一枚のウェハ上に多数のチップを同時に形成し、プロセス終了後、図1に示すような一つのチップサイズの流路形成基板10年に分割する。また、分割した流路形成基板10を、封止板20、共通インク室形成基板30、及びインク室側板40と頃次接着して一体化し、インクジェット式記録ヘッドとする。

【0053】このように構成したインクジェット式記録 ヘッドは、図示しない外部インク供給手段と接続したイ

ンク導入口42からインクを取り込み、共通インク室3 1からノズル関ロ11に至るまで内部をインクで満たし た後、図示しない外部の駆動回路からの記録信号に従 い、下電極膜60と上管極膜80との間に電圧を印加 し、弾性膜50、下電極膜60及び圧電体膜70をたわ み変形させることにより、圧力発生室12内の圧力が高 まりノズル開口11からインク滴が吐出する。

【〇〇54】図6は、このように形成されたインクジェ ット式記録ヘッドの要部平面図及び断面図である。

【0055】本実施形態のインクジェット式配録ヘッド は、図6に示すように、下電程膜60、圧電体膜70及 び上電極膜80からなる圧電素子300が圧力発生室1 2に対応する領域に設けられ、圧力発生室12に対向す る領域で且つ周壁に接触しない領域に、圧電体膜70及 び上電極膜80からなる圧電体能動部320が形成され ている。また、本実施形態では、圧電体膜70及び上電 極膜80は、各圧電体能動部320の長手方向一端部か ら周壁上まで延設され、図示しないが上電極膜80の端 部近傍に外部配線が接続され、各圧電体能動部320の 個別電極となっている。

【0056】一方、下電極膜60は、本実施形態では、 権数の圧電体能動部320の共通電極となっており、並 設された複数の圧力発生窒12に対応する領域に亘って 設けられている。また、圧力発生室12の圧電体膜70 及び上電極膜80が延設される側の端部は、圧力発生室 12の端部近傍でパターニングされている。

【0057】また、このような圧電体能動部320が形 成される圧力発生室12に対向する領域の弾性膜60 は、本実施形態では、圧力発生室12の幅方向両端部か ら中央部に向かって圧力発生室12側に傾斜して設けら れており、横断面が略山形を有する突出部51となって いる。すなわち、弾性膜50の圧力発生塞12に対向す る領域には、実質的に略V字状の増部が形成されている ことになる。

【0058】ここで、突出部51以外の弾性膜50に沿 った面に対する突出部51の観斜角度αは、特に限定さ れないが、30°以下であることが好ましい。また、こ の突出部51の先端部は、鋭いと電場集中が起こり思く 圧離体膜70の破壊が発生する虞があるため、R形状と なっていることが好ましい。

【〇〇59】また、このような突出部51上に形成され る圧電体能動部320を構成する下電極膜60、圧電体 膜70及び上電極膜80は、本実施形態では、それぞ れ、この弾性膜50の形状に沿って成膜されており、幅 方向の断菌が略V字形状となっている。

【〇〇60】このような構成では、圧電体能動部320 の幅を変えることなく、圧電体能動部320を構成する 圧電体膜70の体積が増加されるため、圧電体能動部3 20の駆動力を向上することができる。すなわち、圧力 発生室の12の幅を変えることなく駆動力を向上でき、

圧力発生窒12の単位容積あたりの駆動力が増加する。 また、本実施形態では、弾性膜50の突出部51が圧力 発生室12側に突出して設けられて、圧力発生室12の 容積が小さくなっているため特に効果が大きい。これに より、インク吐出速度を増加することができ、インク吐 出特性を向上することができる。

【0061】また、圧電体能動部320の駆動力が向上 されるため、圧電体能動部320の幅方向端部と圧力発 生富12の幅方向端部との間、いわゆる腕部の幅を狭く することができる。すなわち、圧電体能動部320の幅 を広げて腕部の幅を狭くすると、振動板の剛性が高まる ため、圧電体能動部320の駆動による振動板の変位量 が減少するが、本実施形態では、圧電体能動部320の 駆動力が著しく向上されているため、振動板を十分に変 形させることができ、且つ振動板の耐久性を向上するこ とができる。

【0062】なお、圧力発生室12に対向する領域の弾 性膜50は、圧力発生室12を形成する際に、圧離体能 動部320を構成する各層の内部応力等によって提み変 形が生じて弾性膜50が下方に突出する場合があるが、 本発明は、このような変形を含むものではない。すなわ ち、圧力発生度12に対向する領域の弾性膜50は、上 述したような内部応力を除去した状態でも圧力発生室1 2個に突出した突出部51となっているため、上述のよ うな効果を得ることができる。

【0063】(実施形態2)図7は、実施形態2に係る インクジェット式記録ヘッドの要部断面図である。

【〇〇64】本実施形態は、図7に示すように、圧力発 生室12に対向する領域の弾性膜60を圧力発生室12 とは反対側に突出する突出部51Aとして、この突出部 51Aの形状に沿って圧電体能動部320を設けた以 外、実施形態1と同様である。

【〇〇65】このような構成においても、勿論、実施形 態1と同様な効果を得ることができる。

【〇〇66】(実施形態3)図8は、実施形態3に係る インクジェット式記録ヘッドの要部断面図である。

【0067】図8に示すように、本実施形態では、圧電 体膜70の上電極膜80側の表面を弾性膜60の形状に 沿って形成せず、平面とするようにした以外は、実施形 越1と同様である。

【〇〇68】このような構成においても、勿論、実施形 麒1と同様の効果を得ることができる。

【〇〇69】なお、本実施形態のように、圧電体膜70 の上電機膜80側を平面とするには、例えば、圧電体膜 70をゾルーゲル法等により形成すれば、容易に形成す ることができる。

【0070】(他の実施形態)以上、本発明の各実施形 **憩を説明したが、インクジェット式記録ヘッドの基本的** 構成は上述したものに限定されるものではない。

【0071】例えば、上述した封止板20の他、共通イ

ンク室形成基板30をガラスセラミックス製としてもよ く、さらには、薄肉膜41を別部材としてガラスセラミ ックス製としてもよく、材料、構造等の変更は自由であ

【0072】また、上述した実施形態では、ノズル開口 を流路形成基板10の端面に形成しているが、面に垂直 な方向に突出するノズル開口を形成してもよい。

【〇〇73】このように構成した実施形態の分解斜視図 を関9、その流路の断面を図10にぞれぞれ示す。この 実施形態では、ノズル開口11が圧電索子とは反対のノ ズル基板120に穿設され、これらノズル開口11と圧 力発生室12とを連通するノズル連通口22が、封止板 20、共通インク室形成基板30及び薄肉板41A及び インク室側板40Aを貫通するように配されている。

【〇〇74】なお、本実施形態は、その他、薄肉板41 Aとインク室側板40Aとを別部材とし、インク室側板 … 40Aに開口40bを形成した以外は、基本的に上述し た実施形態と同様であり、同一部材には同一符号を付し て重複する説明は省略する。

【0075】また、勿論、共通インク室を流路形成基板 内に形成したタイプのインクジェット式記録ヘッドにも 同様に応用できる。

【0076】このように、本発明は、その趣旨に反しな い限り、種々の構造のインクジェット式記録ヘッドに応 用することができる。

【〇〇77】また、これら各実施形態のインクジェット 式記録ヘッドは、インクカートリッジ等と連通するイン ク流路を具備する記録ヘッドユニットの一部を構成し て、インクジェット式記録装置に搭載される。図11 は、そのインクジェット式記録装置の一例を示す概略図 である。

【0078】図11に示すように、インクジェット式記 録ヘッドを有する記録ヘッドユニット1A及び1Bは、 インク供給手段を構成するカートリッジ2A及び2日が **着脱可能に設けられ、この記録ヘッドユニット1A及び** 1日を搭載したキャリッジ3は、装置本体4に取り付け られたキャリッジ軸5に軸方向移動自在に設けられてい る。この記録ヘッドユニット1A及び1Bは、例えば、 それぞれブラックインク組成物及びカラーインク組成物 を吐出するものとしている。

【0079】そして、駆動モータ6の駆動力が図示しな い複数の歯率およびタイミングベルトフを介してキャリ ッジ3に伝達されることで、記録ヘッドユニット1 A 及 び1日を搭載したキャリッジ3はキャリッジ軸5に沿っ て移動される。一方、装置本体4にはキャリッジ軸5に 沿ってプラテン8が設けられており、図示しない給紙口 一ラなどにより給紙された紙等の記録媒体である記録シ ートSがプラテン8に巻き掛けられて搬送されるように なっている。

[0080]

【発明の効果】このように本発明では、圧力発生室に対 向する領域の振動板を圧力発生室の幅方向両端部から中 央部に向かって振動板の厚さ方向一方側に傾斜して設け られた突出部とし、この突出部の形状に沿って圧電体層 を設けて圧電体能動部を形成するようにした。これによ り、圧電体能動部の幅を変えることなく、圧電体層の体 積を向上することができ、単位容積あたりの圧電体能動 部の駆動力が増加する。したがって、インク吐出速度を 増加させることができ、インク吐出特性を向上すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係るインクジェット式配 録ヘッドの分解斜視図である。

【図2】本発明の実施形態1に係るインクジェット式記 録ヘッドを示す図であり、図1の平面図及び断面図であ る。

【図3】図1の對止板の変形例を示す図である。

【図4】本発明の実施形態1の薄膜製造工程を示す図で

【図5】本発明の実施形態1の薄膜製造工程を示す図で ある。

【図8】本発明の実施形態1に係るインクジェット式記 録ヘッドの要部平面図及び断面図である。

【闔7】本発明の実施形態2に係るインクジェット式記 録ヘッドの要部断面図である。

【図8】本発明の実施形態3に係るインクジェット式配 緑ヘッドの要部断面図である。

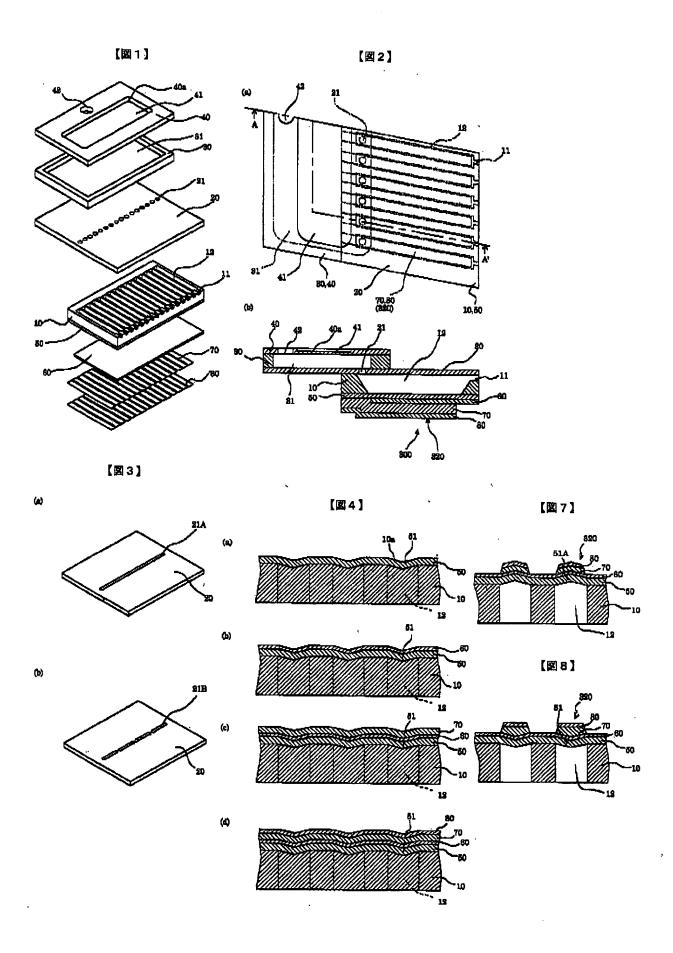
【図9】本発明の他の実施形態に係るインクジェット式 記録ヘッドを示す分解斜視圏である。

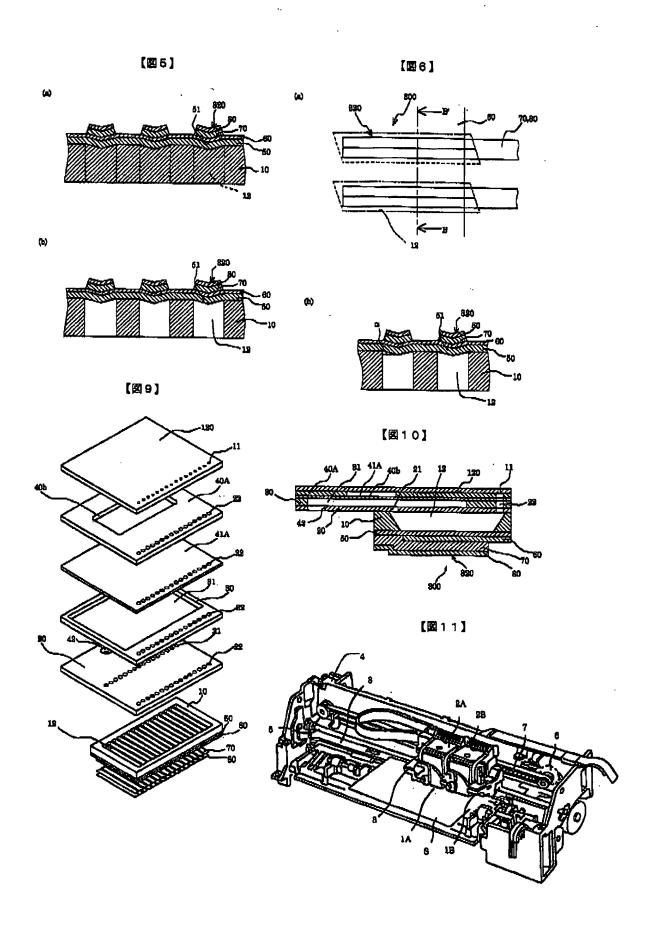
【図10】本発明の他の実施形態に係るインクジェット 式記録ヘッドを示す新面図である。

【図11】本発明の一実施形態に係るインクジェット式 記録装置の概略図である。

【符号の説明】

- 10 流路形成基板
- 12 圧力発生室
- 60 弾性膜
- 5 1 突出部
- 60 下電極膜
- 70 庄電休膜
- 80 上電極膜
- 300 圧電素子
- 320 圧電体能動部.





フロントページの続き

Fターム(参考) 20057 AF37 AF93 AG41 AG42 AG44 A953 AG59 AP11 AP14 AP32 AP34 AP52 AP58 AP57 AQ02 BAOS BA14